

## ОСОБЕННОСТИ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ПОРЯДКОВ В ПЛЕНКАХ $a\text{-C:H}$ , ОБНАРУЖИВАЮЩИХ ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЙ ЭФФЕКТ

© В.Х.Кудоярова, В.Л.Аверьянов, А.В.Чернышов, Т.К.Звонарева

Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе Российской академии наук,  
194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 6 марта 1995 г. Принята к печати 13 марта 1995 г.)

Приводятся результаты детального исследования состава и структуры пленок  $a\text{-C:H}$ , в которых обнаруживается стимулированное ультрафиолетовым излучением изменение оптических свойств. Пленки  $a\text{-C:H}$  были приготовлены двумя методами: магнетронным распылением графитовой мишени в смеси газов  $\text{Ar} + \text{H}_2$  и высокочастотным разложением  $\text{CH}_4 + \text{Ar}$ . Инфракрасная спектроскопия показала, что пленки характеризуются преобладающей моно- или дигидридной формой связи водорода с углеродом в зависимости от условий получения. Концентрация водорода зависела от технологических условий и изменялась от 10 до 20 ат%. Показано, что ультрафиолетовое облучение не приводит к изменению исходной концентрации водорода. Концентрация кислорода в пленках  $a\text{-C:H}$  до и после ультрафиолетового облучения определялась методом резонансных ядерных реакций. Показано, что концентрация кислорода в облученных образцах в 1.5 раза больше, чем в необлученных. Обсуждается роль кислорода в фотоструктурных превращениях.

### 1. Введение

Уникальность свойств пленок  $a\text{-C:H}$  состоит в возможности наличия метастабильных состояний, характеризующихся различными типами связей атомов углерода, включающих в себя гибридизации типа  $sp^3$  (алмаз),  $sp^2$  (графит) и  $sp^1$  (карбон). Между этими состояниями могут происходить переходы, индуцированные различными воздействиями: температурой (отжигом) [1] или облучением ускоренными ионами Ni [2]. В работах [1,2] показано, что отношение гибридизированных атомов углерода  $sp^3/sp^2$  может быть увеличено изохронным отжигом до температур менее 300°C или облучением ускоренными ионами Ni (доза — менее  $10^{12}$  ион/ $\text{см}^2$ ).

Как и в случае других аморфных полупроводников, в частности халькогенидных стекол [3], переходы между различными состояниями могут быть индуцированы поглощением квантов света, вызывающих межзонные электронные переходы.

Фотоиндуцированный сдвиг края оптического поглощения к низким или высоким энергиям (фотопросветление или фотопотемнение) был обнаружен в пленках  $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x:\text{H}$ , полученных реактивным распылением кремниевой мишени в атмосфере  $\text{C}_3\text{H}_8 + \text{Ar}$ <sup>[4]</sup>. Фотопотемнение вызывалось облучением  $\text{Ar}^+$ -лазером с энергией  $h\nu > E_g^0 = 2.4$  эВ пленок  $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x:\text{H}$  в вакууме, а фотопросветление — излучением с такой же энергией на воздухе. Радиационный нагрев пленок при плотности мощности облучения  $\text{Ar}^+$ -лазером ( $\lambda = 488$  нм) 400 мВт/см<sup>2</sup> составлял 3°С. Поэтому это явление носит фотоиндуцированный характер, а не термический. Наиболее ярко изменение оптических свойств наблюдалось в пленках  $a\text{-Si}_{1-x}\text{C}_x:\text{H}$  в составах с большим содержанием углерода,  $x > 0.7$ , что позволило авторам<sup>[4]</sup> предположить, что за это явление ответственны атомы углерода.

Недавно было обнаружено<sup>[5]</sup>, что ультрафиолетовое (УФ) освещение изменяет толщину и коэффициент преломления пленок  $a\text{-C:H}$ . Одновременно пленки становились более прозрачными (эффект фотопросветления). Было показано, что оптическая ширина запрещенной зоны  $E_g^0$  сдвигается в коротковолновую часть спектра. В работе<sup>[5]</sup> было высказано предположение, что обнаруженные изменения оптических свойств целесообразно связать с совокупностью фотохимических и фотоводородных превращений, происходящих в пленках  $a\text{-C:H}$  под воздействием УФ излучения.

Исследование данного явления представляет научный и практический интерес, так как оно может быть использовано как в «мягкой» рентгеновской фотолитографии, так и для превращения при низких температурах (вблизи комнатной температуры) тонких диэлектрических слоев в полупроводниковые, которые могут быть использованы в качестве затворов в тонкопленочных полевых транзисторах<sup>[6]</sup>.

В представленной работе приводятся исследования состава и структуры пленок  $a\text{-C:H}$ , в которых обнаружены стимулированные ультрафиолетовым излучением изменения свойств.

## 2. Методика эксперимента

Пленки  $a\text{-C:H}$  на подложках из  $c\text{-Si}$  и кварца осаждались методом реактивного магнетронного распыления на постоянном токе графитовой мишени в аргоноводородной атмосфере (тип 1) и методом разложения аргонометановой смеси (10%  $\text{CH}_4 + 90\%$  Ar) в тлеющем высокочастотном разряде в реакторе с емкостной связью (тип 2). Исследуемые пленки были получены при температурах подложки 400 К. Толщины пленок составляли 500–6000 Å. Тонкие пленки 500–1500 Å облучались ртутной лампой высокого давления мощностью 150 Вт.

В представленной работе состав пленок  $a\text{-C:H}$ , т.е. содержание водорода и кислорода, определялись с помощью ядерно-физических методов: изучения спектра протонов отдачи<sup>[7]</sup> и резонансной ядерной реакции<sup>[8]</sup>. Типичные спектры протонов отдачи (водорода), измеренные при облучении пленок  $a\text{-C:H}$  толщиной 1500 и 6000 Å ускоренными ионами  $^{12}\text{C}^{+3}$ , приведены на рис. 1.

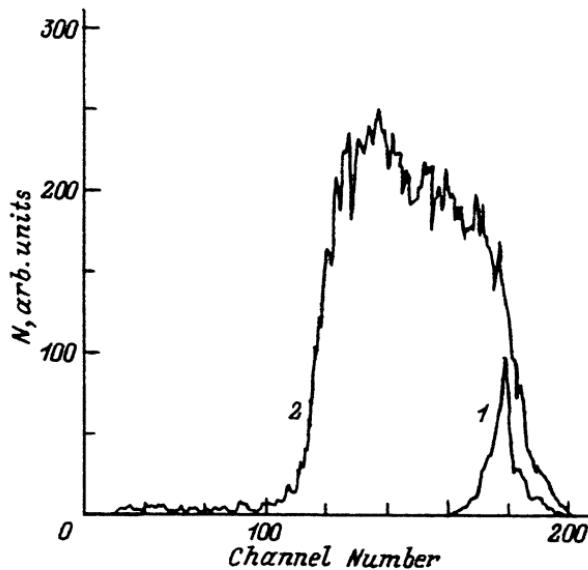


Рис. 1. Спектры протонов отдачи (водорода) для двух пленок а-С:Н различной толщины  $d$ , Å: 1 — 1500, 2 — 6000.

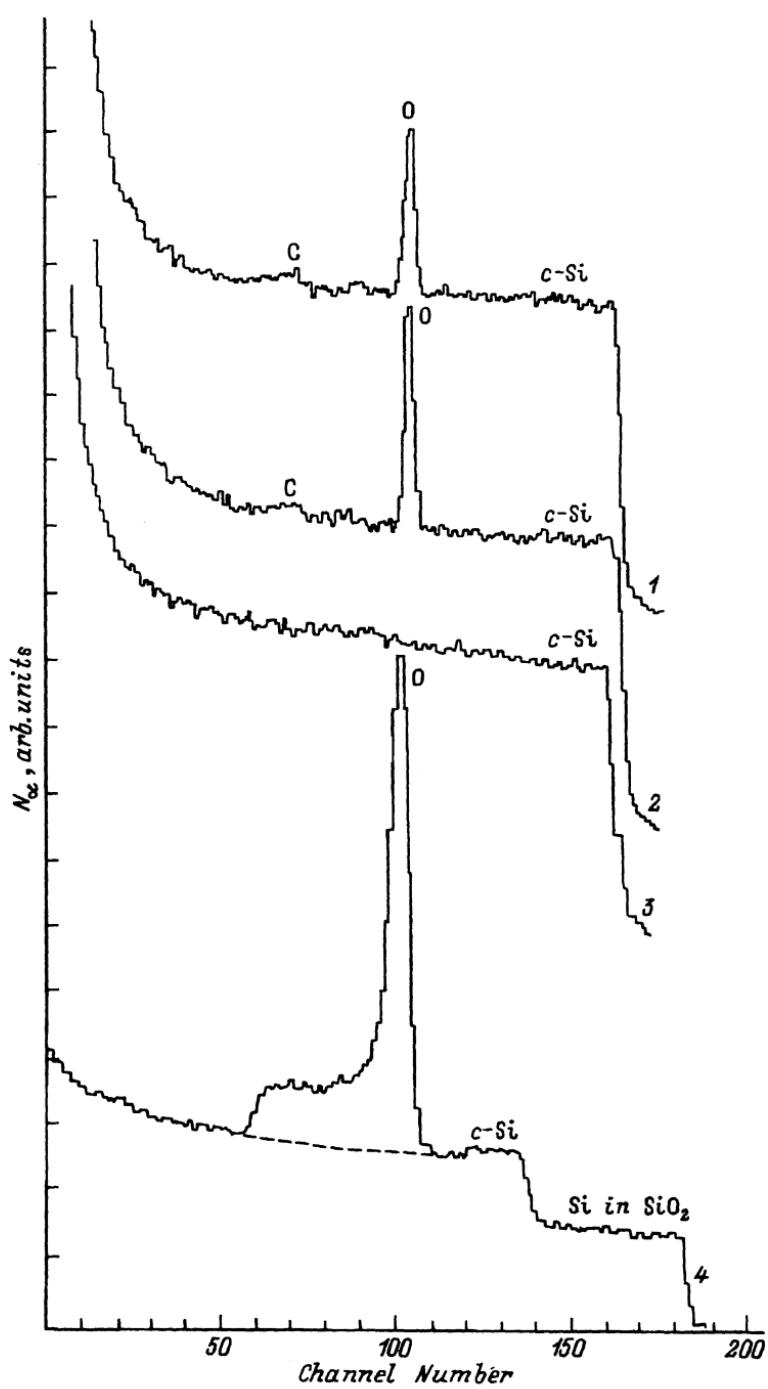
Содержание кислорода оценивалось методом резонансной ядерной реакции  $^{16}\text{O}(\alpha\alpha)^{16}\text{O}$ . Начальная энергия  $\alpha$ -частиц  $E = 3.05$  МэВ. Увеличивая энергию  $\alpha$ -частиц до 3.5 МэВ, мы имели возможность наблюдать резонансную ядерную реакцию  $^{16}\text{O}(\alpha\alpha)^{16}\text{O}$  на поверхности пленки, в ее середине и на границе раздела (пленка а-С:Н—подложка с-Si) и сделать заключение о месте нахождения кислорода. При оценке содержания кислорода использовался калибровочный образец  $\text{SiO}_2$  с известной концентрацией кислорода. На рис. 2 представлены типичные спектры рассеянных  $\alpha$ -частиц на атомах кислорода, углерода и кремния (подложка с-Si). Из спектра  $\alpha$ -частиц, рассеянных на атомах углерода мы имели возможность оценить плотность пленок а-С:Н [8].

Структура пленок а-С:Н исследовалась с помощью инфракрасной (ИК) и рамановской спектроскопии. ИК спектры измерялись в диапазоне 400–5000  $\text{cm}^{-1}$  на двухлучевом спектрометре UR-20. Рамановские спектры наблюдались на двойном монохроматоре SPEX-1403, с использованием линии аргонового лазера 488 нм. Ширина спектральной щели составляла 7  $\text{cm}^{-1}$ .

Полосы поглощения в ИК спектрах или спектры рамановского рассеяния, представляющие собой суперпозицию нескольких полос' или спектров, разлагались с помощью компьютерных программ на соответствующие полосы и спектры гауссовой формы.

### 3. Экспериментальные результаты и обсуждение

Изменение оптических свойств под действием УФ облучения было обнаружено в пленках а-С:Н, полученных двумя вышеуказанными способами (пленки типа 1 и типа 2). Однако этот эффект более ярко проявляется в пленках, осажденных методом реактивного магнетронного распыления (тип 1). Рассмотрим состав и структуру исходных («необлученных») пленок.



**Рис. 2.** Спектры обратно рассеянных  $\alpha$ -частиц на атомах кремния, кислорода и углерода в пленке  $a\text{-C:H}$  на подложке  $c\text{-Si}$ :  
 1 — пленка  $a\text{-C:H}$  на подложке  $c\text{-Si}$  (необлученная), 2 — пленка  $a\text{-C:H}$  на подложке  $c\text{-Si}$  (облученная УФ, время облучения 2.5 ч), 3 — резонансная ядерная реакция  $^{16}\text{O}(\alpha, \alpha)^{16}\text{O}$  на глубине 5000 Å, 4 — пленка  $\text{SiO}_2$  на подложке из кристаллического  $c\text{-Si}$ .

Концентрация водорода  $N_H$ , содержание кислорода  $N_O$  и плотность  $\rho$  для пленок обоих типов приведены в табл. 1.

Таблица 1.

Тип пленки $a\text{-C:H}$	$N_H$ , ат%	$N_O$ , $\text{см}^{-3}$	$\rho$ , $\text{г}/\text{см}^3$
1	9	$7.6 \cdot 10^{20}$	1.60
2	20	$1.0 \cdot 10^{21}$	1.85

Как видно из табл. 1, пленки  $a\text{-C:H}$  (тип 1) характеризуются меньшим содержанием водорода, кислорода и меньшей плотностью, чем пленки типа 2.

ИК спектроскопия позволила нам установить конфигурацию связи атомов углерода с водородом ( $\text{CH}_n$ , где  $n = 1-3$ ) и определить вид гибридизации атомов углерода, связанных с водородом.

На рис. 3 и в табл. 2 приведены нормализованные ИК спектры, соответствующие моде растяжения связи С-Н и наблюдаемые полосы поглощения для обоих типов пленок  $a\text{-C:H}$ . Полоса поглощения в области  $2800-2960 \text{ см}^{-1}$  в общем случае представляет собой суперпозицию пяти перекрывающихся полос поглощения, которые после разложения приписываются различным конфигурациям  $sp^3 \text{CH}_n$  ( $n = 1-3$ ), а полосы поглощения около  $3000-3050 \text{ см}^{-1}$  — конфигурациям  $sp^2 \text{CH}_n$  ( $n = 1-2$ ) [9].

Соотношение между различными видами гибридизации  $sp^3/sp^2$  составляет  $0.97/0.03$  и  $0.91/0.09$  соответственно. Приведенные экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что в обоих типах пленок  $a\text{-C:H}$  основным видом гибридизации углеродных атомов, с которыми связан водород, является  $sp^3$ .

Относительно конфигураций связей следует отметить, что в пленках типа 1 основной является  $sp^3 \text{CH}_1$ , а в пленках типа 2 —  $sp^3 \text{CH}_2$ . В конфигурации  $sp^3 \text{CH}_1$  водород способен только насыщать оборванную связь углерода, в то время как конфигурации  $sp^3 \text{CH}_2$  и  $sp^2 \text{CH}_1$  характерны для полимерных связей [10]. Таким образом, для пленок типа 2 преобладание конфигураций  $sp^2 \text{CH}_1$  является свидетельством наличия полимерной фазы в структуре.

Рамановские спектры в области  $1000-1800 \text{ см}^{-1}$  для пленок  $a\text{-C:H}$  обоих типов приведены на рис. 4. Как видно из этого рисунка, в них наблюдаются характерные моды типа  $G$  ( $1530-1600 \text{ см}^{-1}$ ) и  $D$  ( $1350 \text{ см}^{-1}$ ).

Таблица 2.

Тип пленки $a\text{-C:H}$	Полосы в спектре			
	1	2	3	4
	$sp^3 \text{CH}_2$ симм.	$sp^3 \text{CH}_2$ антисимм.	$sp^3 \text{CH}_1$	$sp^2 \text{CH}_1$ олефин
Тип 1	2850	—	2910	3000
Тип 2	2850	2925	—	3000

Примечание. Номера полос 1-4 отмечены стрелками на рис. 3.

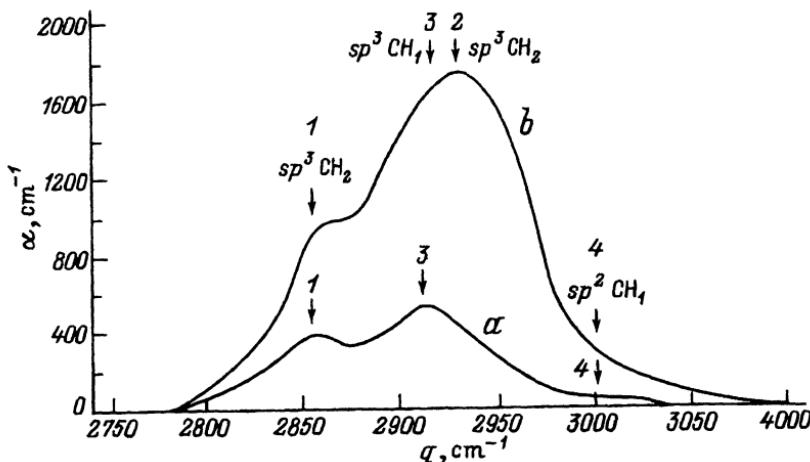


Рис. 3. Инфракрасные спектры для двух типов пленок а-С:Н:  
а — тип 1, б — тип 2. Числы 1–4 соответствуют номерам полос спектра в табл. 2.

Анализ рамановских спектров — положение линий ( $\omega_G, \omega_D$ ), их ширина  $\Delta\omega_G, \Delta\omega_D$  (величины, соответствующие половине высоты пика) и отношение интенсивностей мод  $I_D/I_G$  — позволяет сделать вывод о близости структуры пленок а-С:Н к структуре алмаза, полимера или структуре, образованной графитоподобными кластерами размером 5–20 Å [11,12]. Полученные нами экспериментальные значения вышеуказанных параметров рамановских спектров после их разложения на моды  $G$  и  $D$  для пленок обоих типов приведены в табл. 3. Они хорошо согласуются с результатами работ [11,13]. Из таблицы следует, что наблюдается сдвиг линий  $G$  и  $D$  в область более высоких частот, уширение линии  $G$  и увеличение отношения интенсивностей линий  $I_D/I_G$ .

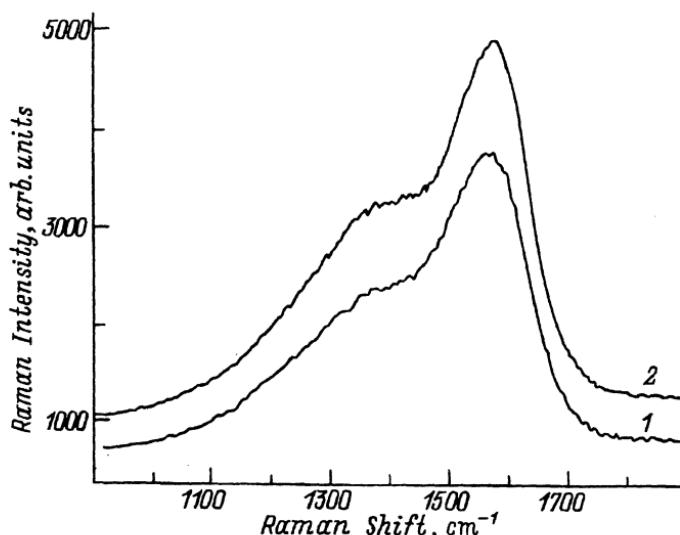


Рис. 4. Рамановские спектры для двух типов пленок а-С:Н:  
1 — тип 1, 2 — тип 2.

Таблица 3.

Тип пленки а-С:Н	$\omega_D$ , см <sup>-1</sup>	$\omega_G$ , см <sup>-1</sup>	$\Delta\omega_D$ , см <sup>-1</sup>	$\Delta\omega_G$ , см <sup>-1</sup>	$I_D/I_G$
Тип 1	1396	1568	352	140	0.73
Тип 2	1404	1576	352	198	0.79

Наблюдаемые параметры рамановских спектров свидетельствуют о наличии графитовых кластеров и доминировании трехкоординированных атомов углерода ( $sp^2$ ) над четырехкоординированными ( $sp^3$ ) [11]. Размер кластеров для пленок типа 1 и 2 составляет 15 и 20 Å соответственно [12].

Рассмотрим влияние УФ облучения на состав пленок а-С:Н. На рис. 5 приведены спектры протонов отдачи необлученной (a) и облученной (b) пленок. В пределах точности измерений (15% [7]) мы не обнаружили изменения концентрации водорода (в обеих пленках она равнялась 9 ат%).

Однако в облученных пленках наблюдается увеличение в 1.5 раза концентрации кислорода (от  $10^{21}$  до  $1.48 \cdot 10^{21}$  см<sup>-3</sup>). На рис. 2 приведены резерфордовские спектры обратно рассеянных  $\alpha$ -частиц на атомах кислорода в необлученной (1) и УФ — облученной (2) пленках а-С:Н. Здесь же приведен спектр (3), наблюдаемый при увеличении энергии  $\alpha$ -частиц (чтобы иметь возможность наблюдать резонансную ядерную реакцию  $^{16}\text{O}(\alpha, \alpha)^{16}\text{O}$  на кислороде, который мог бы находиться на границе (пленка-подложка *c-Si*)). Как видно из рис. 2, кислорода на этой границе не обнаружено, и весь наблюдаемый кислород содержится в пленке а-С:Н. К сожалению, сделать какие-либо заключения об изменениях структуры пленок при УФ облучении из рамановских спектров нам не удалось из-за сильной люминесценции, которую мы наблюдали на тонких необлученных и облученных пленках.

Современное представление о структуре пленок а-С:Н, имеющих те же значения концентрации водорода, плотности и оптической ширины запрещенной зоны, как и в полученных нами пленках а-С:Н, основано на результатах исследования резонансного рамановского рассеяния [14], оптической ширины запрещенной зоны [15] и оптических констант  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_2$  [16].

Структура пленок а-С:Н может быть представлена в виде графитовых кластеров, состоящих из 4 или более 6 членных колец, где углеродные атомы обладают гибридизацией  $sp^2$ . Эти кластеры связаны между собой атомами углерода, для которых характерна гибридизация  $sp^3$ . Полимерная фаза, по-видимому, также выполняет роль связующей ткани. Другими словами, структура а-С:Н представляет собой сетку из  $sp^2$ -связанных атомов углерода, поперечно-пересеченную углеводородами. Степень пересеченности зависит от наличия и количества полимерной фазы.

Следует отметить, что полимерная фаза выполняет как бы двойную роль: с одной стороны, создавая поперечно-пересеченную углеродную сетку, обеспечивает ее твердость, с другой стороны (если ее не больше, чем 50%), делает пленки а-С:Н более «мягкими», полимероподобными [10]. Как было показано выше, доля полимерной фазы зависит от технологических условий получения и ее больше в пленках типа 2.

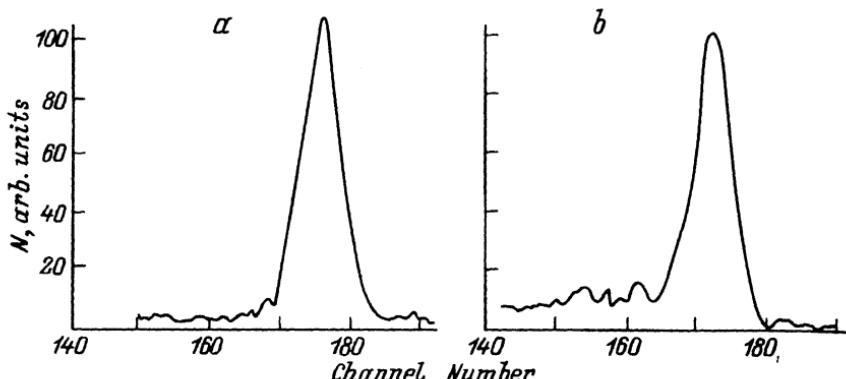


Рис. 5. Спектры протонов отдачи (водорода) в необлученной (а) и облученный УФ в течение 2.5 ч (б) пленках а-С:Н.

Известно, что энергетические состояния в хвостах зоны проводимости ( $\Delta E_c$ ) и валентной зоны ( $\Delta E_v$ ) определяются  $\pi$ -состояниями  $sp^2$ -связанного углерода в углеродных кластерах [16]. Иными словами, кроме концентрации водорода и ближнего порядка (гибридизации углеродных атомов  $sp^3$  или  $sp^2$ ), средний (промежуточный) порядок также определяет оптическую ширину запрещенной зоны  $E_g^0$ . Энергия УФ излучения ртутной лампы близка к энергии возбуждения  $\pi$ -связи (3.5 эВ). Энергии  $\sigma$ -связи (4.8 эВ) [14] и С-Н-связи (4.3 эВ) [17] несколько больше и, по-видимому, они не возбуждаются и не разрываются. Поэтому УФ облучение не вызывает изменения концентрации водорода в пленках.

УФ облучение может возбудить или разорвать  $\pi$ -связь, это в свою очередь приводит к увеличению плотности состояний в хвостах зон и тем самым к уменьшению  $E_g^0$ . Экспериментальные результаты свидетельствуют об обратном. Причиной увеличения  $E_g^0$ , по-видимому, является кислород, который способен замкнуть оборванную связь углерода. Так как пленки а-С:Н типа 2 (напомним, что они получены ВЧ разложением метан-argonовой смеси) — более плотные и в них обнаружено большее содержание кислорода, в них эффект влияния УФ облучения выражен менее ярко.

Работа частично поддержана Министерством обороны США.

#### Список литературы

- [1] B. Dishler, A. Bubenzer, P. Koild. Sol. St. Commun., **48**, 105 (1983).
- [2] J.W. Zou, K. Schmidt, K. Reichelt, B. Strizker. J. Vac. Sci. Technol., **A6**, 3103 (1988).
- [3] B.T. Kolomietz, V.M. Lyubin. Mater. Bull., **13**, 1343 (1978).
- [4] S. Iida, S. Ohki. Japan J. Appl. Phys., **21**, L62 (1982).
- [5] В.Л. Аверьянов, Т.К. Звонарева, А.В. Чернышев, С.Г. Ястребов. ФТТ, **33**, 3410 (1991).
- [6] J.I.B Wilson, A. Qayyum, S. AL-Sabbagh, M. Jubber, P. John. J. Non-Cryst. Sol., **115**, 84 (1989).
- [7] G.M. Gusinskii, I.V. Kudryavtsev, V.Kh. Kudoyarova, O.A. Naidenov, L.A. Rassadin. Semicond. Sci. Technol., **7**, 881 (1992).
- [8] G. Foti, J.W. Mayer, E. Rimini. In: *Ion Beam Handbook for Material Analysis*, ed. by J.W. Mayer, E. Rimini (N.Y., Acad. Press., 1977) part 1, p. 21.

- [9] D.R. McKenzie, R.C. McPhedran, N. Savvides, D.J.H. Cockayne. *Thin. Sol. Films*, **108**, 247 (1983).
- [10] F.W. Smith. *J. Appl. Phys.*, **55**, 764 (1984).
- [11] R.O. Dillon, A. Woollam. *Phys. Rev. B*, **29**, 3482 (1984).
- [12] F. Touinstra, J.L. Koenig. *J. Chem. Phys.*, **53**, 1126 (1970).
- [13] H. Shimizu, S. Nakao, H. Kusakabe, N. Noda. *J. Non-Cryst. Sol.* **114**, 196 (1989).
- [14] J. Wagner, M. Ramsteiner, Ch. Wild, P. Koild. *Phys. Rev. B*, **40**, 1817 (1989).
- [15] J. Robertson, E.P. O'Reilly. *Phys. Rev. B*, **35**, 2946 (1987).
- [16] J. Robertson. *Adv. Phys.*, **35**, 317 (1986).
- [17] J. Bullot, M.P. Schmidt. *Phys. St. Sol. (b)*, **143**, 345 (1987).

Редактор Т.А. Полянская

## Particular properties of long- and mid-range order of $\alpha$ -C:H films displaying the photoinduced effect

*V.Kh.Kudoyarova, V.L.Averyanov, A.V.Chernysnov, T.K.Zvonareva*

A.F.Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences,  
194021 St.Petersburg, Russia

---